

「高輝度・高効率次世代レーザー技術開発」プロジェクト  
委託予定先一覧

研究開発項目	テーマ名	委託予定先
①「高品位レーザー加工技術の開発」、 ②「高出力レーザーによる加工技術の開発」、 ④「次世代レーザー及び加工の共通基盤技術開発」		国立大学法人東京大学、 三菱電機株式会社、 国立大学法人大阪大学、 スペクトロニクス株式会社、 浜松ホトニクス株式会社、 ギガフォトン株式会社、 国立研究開発法人産業技術総合研究所
③「次々世代加工に向けた新規光源・要素技術開発」	フォトリック結晶レーザーの短パルス化・短波長化	国立大学法人京都大学、 スタンレー電気株式会社
	高品質 AlN 結晶基板を用いた最短波長領域高出力深紫外 LD の研究開発	国立研究開発法人理化学研究所、 国立大学法人山口大学
	高効率加工用 GaN 系高出力・高ビーム品質半導体レーザーの開発	パナソニック株式会社
	高出力・高ビーム品質動作を可能とする新型面発光レーザーの研究開発	国立大学法人東京工業大学、 富士ゼロックス株式会社
	高効率・高出力量子ドットレーザーの研究開発	国立大学法人東京大学、 三菱電機株式会社
	革新的小型・高効率 UV レーザー光源の開発	株式会社金門光波、 国立大学法人大阪大学、 公益財団法人レーザー技術総合研究所
	(※) 高輝度青色半導体レーザー光源技術開発	国立大学法人大阪大学

但し、※印のテーマは研究開発項目④「次世代レーザー及び加工の共通基盤技術開発」にて実施する。

以上